

## ⑫ 公開特許公報(A)

昭57—103292

(1) Int. Cl.<sup>3</sup> H 05 B 6/72 識別記号

庁内整理番号 7715-3K 砂公開 昭和57年(1982)6月26日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

## 図高周波加熱装置

願

頭 昭55-180670

②特②出

願 昭55(1980)12月19日

の発 明

音 告村博文

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

@発 明 者 池田信夫

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

仰代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

明湖世

1、発明の名称

高周波加索安置

- 2、 特許請求の範囲
  - (1) 被加熱物を収納する加熱量と、高崗吸電磁放 を発展する高崗政発展器と、この高崗改発振器 からの高層波電磁波を上記加熱量化海く略矩形 状の導改管を有し、上記導改管の単面と加熱量 を開口部で結合し、上記開口部は加熱量上部に 位置し、かつ開口部の電波進行方向の寸法を高 周波電磁放の収長の光以上としたことを特徴と した高周波加熱装置。
  - (2) 上記掃口部に対向する専扱管の議面をテーバ 状に形成したことを特徴とする特許請求の範囲 第1項に記載の高制波加熱接触。
- 3、発明の詳細な説明

本発明は再议智給軍をする高島吸加器要置において、均一加熱や出力に有利な垂直な電界で加熱 室内に加張する方法を提供するものである。

垂直電界で加熱室を励張することは加熱室内の

食品の変動(負荷変動)に対して加機室内の励盛 モードの変動が少ない。したがって高陶牧インピーダンスの変化も少いことから分布の均一性や高 関政出力の特性について有利であることは従来か 5知られていた。

垂直電界で加熱室を励振する方法として加熱室上部に直接マグネトロンを取付ける方法があるが、
この方法は加熱室内の穿出気温度を上昇させて調理するいわゆるオープンレンジの場合、マグネトロンの耐熱性が問題となり不都合である。

そとで第1 図に示すように加熱室1 の側面から 等政哲2を介して加熱室を励張することが考えられるが、この方法であると電界4 は垂直になるが、 加熱室側面から軍政を供給するので加熱量の加熱 パランスが感く、同じ調測物(負荷)を複数個加 熱する場合、均一な加熱状態とならない。

また導変智で加熱室上部から電便を供給する場合は第2凶に示すような構成になり、加熱室内の 電料4の励振が水平になってしまい期待するよう な特性が出なくなってしまうという問題があった。 3 ~-- 9

そこで 不発明 は 加 微量と 時 を 日 面 の 間 口 で 超 台 し 、 と の 開 口 部 の 唯 彼 の 進 行 方 向 の 寸 法 を 発 被 皮 の 必 彼 長 以上 と し 、 明 口 位 遺 を 加 熱 累 の 上 面 に 設 け る こ と に よ り 加 熱 室 内 に 能 直 能 昇 を 励 振 す る も の で あ り 、 以 下 本 轮 明 の 一 実 施 例 に つ い て 脱 明 す る 。

第3図において、加熱室1の上部に導放管2と 結合する開口部を設けており、高周放発振器であるマクオトロン3からの高周放電磁板は導政管2 を伝搬し加熱室1の上部の開口部から加熱室内に 供給される。

そして上記開口部には加熱室1内の熱気がマグネトロン3に伝わらないように低損失性のカバー5が設けられている。また開口部は導破管2の電破の進行方向の寸法を始級長以上に形成しているので、導破管2内の電界4と同じ方向に加熱室内を励振することができ、スタラーやターンテープルなどの均一化手段を組合せることにより加熱パランスのよい均一加熱が可能となる。

次に第4図に示すものは本発明の他の実施例を

5 ~->

す断面図である。

1 ·····加熱室、2 ······ 導波智、3 ····· マグネトロン、4 ······ 館舁、5 ·····カバー。

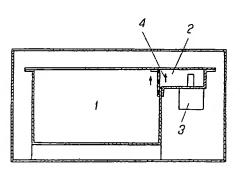
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

以上脱物したように本発明によれば次のような 効果が期待できる。

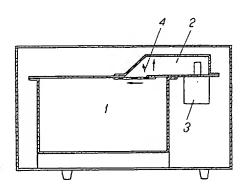
- (1) 電波が加熱室上部から態直電界で加熱室を励振するので、負荷変励による加熱室内の励張モードの変化が少なく、単一負荷の均一加熱対策を行えば他のいろいろな負荷の均一化が図れる。
- (2) 翡頂電界であるので負荷変動に対するインピーダンスの変化が少なく、負荷変動に対しても 発掘器が最高効率で働くため効率が良く省エネ ルギーが関れる。
  - (3) 導放質給合方式であるのでヒータ加熱との組合せも容易にできる。
- 4、 図面の簡単な説明

第1 図, 第2 図は従来例を示す高周収加熱装置 の断面図、第3 図は本発明の一実施例を示す高周 吸加熱装置の断面図、第4 図は同他の実施例を示

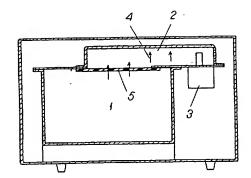
第 1 図



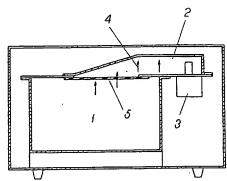




**新 3 図** 



第 4 医



-399-